

Investor Relations 2018

Total Gas Solution

WONIK MATERIALS



DISCLAIMER

TOTAL GAS SOLUTION WONIK MATERIALS

2018년 1분기 실적은 외부 감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료이며 내용 중 일부는 외부 감사인의 감사 과정에서 달라질 수 있습니다.

이 자료에 포함된 회사의 재무성과에 대한 모든 정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결·별도 기준의 영업실적입니다.

본 자료에 포함된 내용은 기관투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사 원익머트리얼즈(이하"회사)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 Presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 "예측정보"는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다. 위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며, 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)



CONTENTS

- I. 경영실적
- II. Company Overview
- III. Investment Highlight
- IV. Appendix

TOTAL GAS SOLUTION
WONIK MATERIALS



경영 실적



'18년 1분기 경영 실적

TOTAL GAS SOLUTION WONIK MATERIALS

2018년 1분기 경영 실적 (연결기준)

(단위: 백만원, %)

2018년 1Q							
구 분	2018.1Q	2017.4Q	QOQ	QOQ (%)	2017.1Q	YOY	YOY (%)
매 출 액 (Sales)	48,889	56,349	△7,460	△13.2%	45,267	+3,622	+8.0%
영업이익 (O.P)	6,664	8,917	△2,253	△25.3%	7,216	△552	△7.6%
(%)	13.6	15.8%	-	-	15.9%	-	-

* K-IFRS 적용 기준

2018년 1분기 경영 실적 (별도기준)

(단위: 백만원, %)

2018년 1Q							
구 분	2018.1Q	2017.4Q	QOQ	QOQ (%)	2017.1Q	YOY	YOY (%)
매 출 액 (Sales)	46,510	53,409	△6,899	△12.9%	42,139	+4,371	+10.4%
영업이익 (O.P)	7,667	9,429	△1,762	△18.7%	7,559	+108	+1.4%
(%)	16.5%	18.0%	-	-	17.9%	-	-
EBITDA	17,087	13,060	+4,027	+30.8%	12,254	+4,833	+39.4%
(%)	36.7%	24.5%	-	-	29.1%	-	-
당기순이익	9,962	-2,602	+12,564	+482.9%	5,944	+4,018	+67.6%
(%)	21.4%	-4.9%	-	-	14.1%	-	-

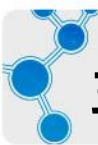
* K-IFRS 적용 기준

TOTAL GAS SOLUTION
WONIK MATERIALS



Company Overview

- I. 회사개요
- II. 사업영역
- III. 성장연혁(History)
- IV. Corporate Identity



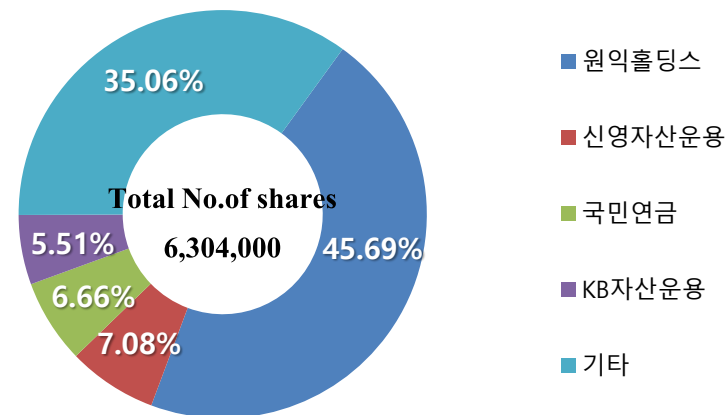
회사 개요

TOTAL GAS SOLUTION WONIK MATERIALS

○ 일반 현황

회사명	(주)원익머트리얼즈
대표이사	한 우 성
설립일	2006년 12월 04일
발행주식수	6,304,000 (2018.03.31 기준)
자본금	31.5억원 (2018.03.31 기준)
임직원수	317명 (2018.03.31 기준)
주요사업	고순도 특수가스 제조업
본사 및 양청사업장	충북 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30 - 대지 50,845㎡ / 건물 5,636㎡
양청2사업장	충북 청주시 청원구 오창읍 655-10 - 대지 68,970㎡
오창사업장	충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업3로 112 - 대지 20,837㎡/건물 6,760㎡
전의사업장	세종특별자치시 전의면 산단길 21-125 - 대지 42,160㎡ /건물 6,714㎡
홈페이지	www.wimco.co.kr

○ 주주구성 (2018.03.31 기준)



Shareholder	No.	Ownership	Remarks
원익홀딩스	2,880,000	45.69%	Major Shareholder
신영자산운용	446,046	7.08%	
국민연금	419,868	6.66%	
KB자산운용	347,233	5.51%	
Others	2,210,853	35.06%	
합 계	6,304,000	100.00%	

- 18년03월31일 기준 임원,주요주주특정 증권 등 소유상황 보고서 및 주식등의 대량보유상황보고서를 참조하여 작성하였으므로 주주들의 실제 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있음



新공정 개발 시 필수 고려되며, 공정 수율과 직결되는 핵심 재료
반도체, LCD, OLED 등 다양한 분야 적용



○ 반도체 및 디스플레이 공정의 특수가스 주요영역

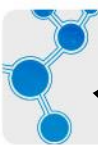




주요품목 현황

TOTAL GAS SOLUTION WONIK MATERIALS

주요품목		용도 및 특징
제 품	F2 Mix	◇ 반도체 증착장비 세정(Cleaning)에 사용되는 가스 - 순도 99.9% 이상 - 반도체 Device 미세화에 따라 기존 Wet Cleaning에서 F2 Mix Dry Cleaning 공정 채택을 증가 전망
	C4F8	◇ 반도체 및 Display 제조공정 중 에칭(Etching)에 사용되는 가스 - 순도 99.999% 이상 - 전통적으로 산화막 식각공정에 사용되는 특수가스 Device미세화에 따라 에칭용 가스의 적용공정 및 사용량이 지속적으로 증가할 것으로 전망
	N2O	◇ 반도체, LCD 및 AMOLED 제조공정 중 증착공정에 사용되는 가스 - 순도 99.9995% - 반도체, LCD 및 AMOLED 공정에서 SiH4과 결합하여 실리콘옥사이드(SiO2)의 산화막을 증착시키는데 사용. - 전자산업의 용도 이외에 저순도 N2O는 의료용 마취제로도 사용됩니다
	NH3	◇ 반도체, LCD, 결정계 태양전지 및 LED 제조공정에 사용되는 가스 - 순도 99.9995%(5N5) ~ 99.99999%(7N) - 반도체, LCD 공정에서 SiH4과 결합, 실리콘나이트라이드(Si3N4)절연막을 증착시 사용. LED공정에서는 트리메틸갈륨(TMGa)과 결합하여 질화갈륨(GaN)막질 증착시 사용 - LED 제조공정에서는 최고순도인 99.99999%의 순도가 요구.
	Laser Mix	◇ AMOLED 제조공정 중 열처리(Annealing) 공정 및 반도체 제조공정 중 Lithography 공정의 광원으로 사용되는 가스 - 순도 99.999% 이상 - AMOLED Panel 제조시 Amorphous Si 형태로 증착된 막질을 Poly-Si 로 변환시키기 위한 열처리 공정에 사용되는 특수가스 - 반도체 Lithography공정 중 패턴을 형성시키기 위한 노광공정의 광원으로 사용되는 가스로 일반적으로 ArF, KrF 등으로 나뉩니다.
상 품	CH2F2	◇ 반도체 및 Display제조공정 중 에칭(Etching)에 사용되는 가스 - 순도 99.999% 이상 - 전통적으로 질화막 식각공정에 사용되는 특수가스로 Device미세화에 따라 에칭용 가스의 적용공정 및 사용량이 지속적으로 증가할 것으로 전망
	Si2H6	◇ 반도체 제조공정 중 Diffusion(확산) 및 CVD 공정에 사용되는 가스 - 순도 99.998% - 반도체 Device의 미세화로 인해 기존의 SiH4으로 구현이 불가능한 공정에 실리콘 증착으로 사용되는 신규 소재입니다. - SiH4 가스대비 반응온도, 증착속도, 접촉면의 거칠기 등에서 탁월한 성능의 가스
	GeH4 Mix	◇ 반도체, LCD 및 박막형 태양전지의 실리콘게르마늄(SiGe)막 형성용 가스 - 순도 99.999% - Ge은 Si과 구조적으로 유사한 동일 족의 원소이며, 대부분 SiH4와 결합하여 실리콘게르마늄(SiGe) 형태로 증착되는 가스 입니다. - 증착된 막질이 실리콘(Si) 단독으로 사용한 것과 유사한 구조와 성능을 가지고 있으나, 전기전도도 측면 및 불순물 확산방지 측면에서 탁월한 특성을 나타냅니다.
	CO2	◇ 반도체 제조공정 중 Cleaning 및 Photo Immersion 공정에 사용되는 가스 - 순도 99.999%, 99.95% - 고순도 CO2 (99.999%)는 Chemical bubble 또는 O3 발생용으로 사용되나, 저순도 CO2 (99.95%)는 Device 미세화에 따른 공정 개선 목적으로 Wafer Cleaning 공정에 사용되며, Photo Immersion 공정에도 사용되는 가스입니다.



성장연혁(History)

TOTAL GAS SOLUTION WONIK MATERIALS

특수가스 분야의 국산화를 선도하며 고도 성장을 이어온 “원익머트리얼즈”

고순도 NH3, NO, BF3 등 “국내 최초 국산화”

F2 혼합가스, BCl3 혼합가스 등 “국내 유일 생산”

2006~2017
CAGR 23%

2004

- NH3 하이닉스반도체 공급
- 6N5 NH3 Y Cylinder LED 업계 공급
- NH3 Y Cylinder 삼성반도체 공급

2003

- 5N5 NH3 정제기술 개발
- PH3 혼합가스 삼성반도체 外 공급

2005

- 삼성반도체 300mm FAB LINE 공급
- 삼성반도체와 제조 / 분석 기술 JDP 체결
- C3F8 Y Cylinder, 3N5 NO, 5N5 N2O 삼성반도체 공급

2006~2007

- 7N NH3 Y Cylinder 삼성전기, LG이노텍 등 LED업체 공급
- 삼성 AMOLED용 Gas 15종 공급
- 삼성LCD LTPS용 Gas 7종 공급
- NH3 ISO Tank 대용량 공급시스템 개발 특허 등록
- 3N5 NO 정제장치 개발 특허 등록
- 美 VOLTAIX社 GeH4 Gas 독점 공급계약 체결

2008

- 삼성반도체 PLAD용 BF3 공급 및 20% F2 Gas 공급
- 반도체의 날 지식경제부장관표창 수상
- 무역의 날 삼천만불 수출의 탑 수상

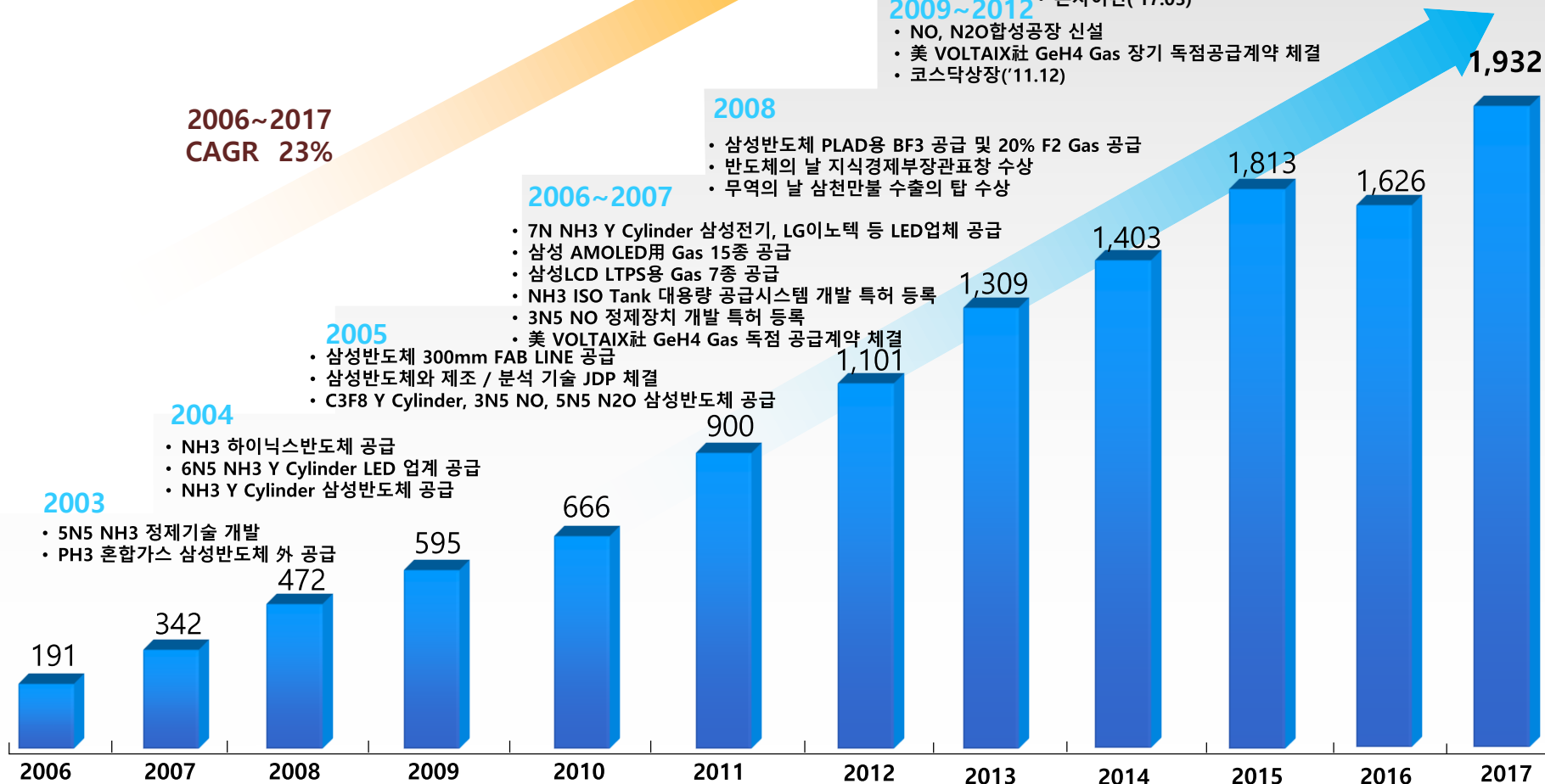
2009~2012

- NO, N2O합성공장 신설
- 美 VOLTAIX社 GeH4 Gas 장기 독점공급계약 체결
- 코스닥상장('11.12)

2013~2017

- 삼성강소기업 선정
- 원익서안반도체유한공사(중국)설립
- 노바켄유한책임회사 (미) 출자 (50.7%)
- 오창공장 AEO 인증
- 삼성전자 Best Partner Award 수상
- 본사이전('17.03)

(단위:억원)





High Tech 분야 핵심 소재 전문기업

높은 수준의 정제 /혼합/ 합성 기술 보유

100여종의 다양한 품목 포트폴리오

삼성전자 등 글로벌 메이저 고객사

생산 인프라

충북 오창 사업장

세종특별시 전의 사업장

충북 양청 사업장

안정적 사업영역

반도체

AMOLED

LCD

LED

메이저 고객사

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG DISPLAY

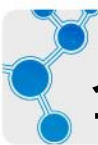
SK hynix

TOTAL GAS SOLUTION
WONIK MATERIALS



Investment Highlights

- I. 성장성 및 수익성
- II. 전 공정 대응 가능 제품 Line-up
- III. 진입장벽 높은 시장 내 포지션
- IV. 안정적 공급체계 확보



全 공정 대응 가능 제품 Line-up

TOTAL GAS SOLUTION WONIK MATERIALS

100여종의 제품 Line-up을 통해 전 공정에 신속히 대응 가능한 노하우 확보

Applications	Semiconductor	LCD	AMOLED
CVD / Diffusion	N2O, NH3, C3H6, NO GeH4, MMS, HCDS Si2H6, Si3H8, TSA	N2O, NH3	N2O, NH3
Etching / Cleaning	C4F8, SF6, CO2 SiCl4, CF4, CH2F2, CHF3 F2 mixtures, C2H4 mixtures Cl2 mixtures	SF6, C4F8, Cl2 BCl3, HCl	SF6, C4F8 Cl2, BCl3, C2HF5 CF4, CHF3
Implant / Doping	BF3, Xe PH3 mixtures, BCl3 mixtures B2H6 mixtures	PH3 mixtures B2H6 mixtures	BF3, PH3 mixtures
Others	Laser gases Forming gases		ELA Gases Rare Gases



Major Customers

TOTAL GAS SOLUTION WONIK MATERIALS

Semiconductor



FPD



LED



etc.





제품의 신뢰성 / 생산 인프라 / 환경 규제 대응력 등을 보유한 기업만이 우위 선점 가능

독보적 기술력 보유

품질은 반도체 / 디스플레이 최종 수율 향상과 직결

- 100여가지 제품 / 상품과 관련된 합성 / 정제 / 분석 기술 보유
- 기술 및 장치 관련 특허권 21개 보유

선행 투자 자금 필요

최소 1년 이상의 선행 투자 필수

- 오창사업장 / 전의사업장 / 양청사업장 투자 확보
 - 특수가스별 시장 확대에 대응을 위한 다량 생산 설비 구축 완료
 - 프리커서 및 Laser Mix 국산화 를 위한 설비 구축

높은
진입장벽

고객사의 높은 제품 신뢰도 확보

본격적 공급은 생산라인별 테스트 기간을 고려
최소 6개월 이상의 시간 소요

- 삼성 / 하이닉스 등의 안정적 공급 지속

품질 / 환경 / 안전 / 규제 등에 따른 대응력 보유

- 품질/환경/안전 통합경영시스템 업체 인증
 - SEQMS 31001 인증 획득
(ISO 9001 / ISO 14001 / OHS 18001 통합 인증)



Appendix1) 요약 재무제표 – 재무상태표

(단위:백만원)

Classification	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018. 1Q
Current asset	84,847	66,772	72,264	69,821	72,833	74,421	61,478
Non-liquid assets	67,263	113,768	139,394	164,335	189,475	205,200	222,569
Total assets	152,110	180,540	211,659	234,156	262,308	279,621	284,046
Current liabilities	17,421	16,105	26,812	25,718	36,659	34,615	31,031
Non-liquid liabilities	4,466	9,878	6,116	5,945	4,630	3,166	2,388
Total liabilities	21,887	25,983	32,927	31,663	41,289	37,781	33,419
Equity Attributable to Owners of parent	130,223	152,012	171,977	196,192	214,573	235,909	246,214
Capital share	2,955	3,070	3,081	3,096	3,123	3,152	3,152
Capital surplus	56,275	59,060	59,461	61,401	64,921	68,673	68,371
Earned surplus	68,054	87,251	107,505	128,971	144,655	165,015	174,774
Others	2,939	2,631	1,930	2,724	1,874	-931	-83
Non-controlling interests	-	2,545	6,755	6,301	6,446	5,931	4,413
Total stockholders equity	130,223	154,557	178,732	202,493	221,019	241,840	250,627

- 2013년~2017년은 연결기준임 (K-IFRS기준임)
- 2012년은 개별기준임 (K-IFRS기준임)



Appendix1) 요약 재무제표 – 손익계산서

TOTAL GAS SOLUTION WONIK MATERIALS

(단위:백만원)

Classification	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018. 1Q
Sales	110,097	130,023	145,152	192,469	175,041	203,032	48,889
COGS(-)	75,850	91,487	100,771	134,834	126,644	134,252	33,548
Gross profit	34,246	38,536	44,381	57,635	48,397	68,780	15,341
SG&A(-)	10,762	12,866	17,040	24,304	24,986	35,898	8,677
Operating profit	23,485	25,670	27,340	33,331	23,411	32,882	6,664
Other income(+)	571	730	2,413	2,515	2,706	2,934	1,247
Other expenses(-)	395	2,669	1,060	885	3,018	6,152	149
Financing income(+)	2,169	1,621	1,365	1,550	1,804	1,225	354
Financing cost(-)	187	236	441	1,421	1,696	1,201	341
Equity gains and losses on Affiliated Companies	-	(485)	(2,443)	249	260	(2,854)	3,427
Goodwill Impairment loss in Subsidiaries	-	-	-	(7,199)	(3,489)	(3,191)	-
Income before income taxes	25,642	24,631	27,175	28,140	19,978	23,643	11,202
Income tax expense(-)	5,701	5,547	7,139	6,917	4,308	5,889	4,783
Net profit	19,961	19,084	20,036	21,223	15,670	17,754	6,419

- 2013년~2017년은 연결기준임 (K-IFRS기준임)
- 2012년은 개별기준임 (K-IFRS기준임)



THANK YOU